研究論文

Received September 5, 2006; Accepted February 20, 2007

ディジタルホログラフィーによる偏光測定と応力解析への応用

照井 義隆・横田 正幸・山口 一郎

群馬大学工学部電気電子工学科 〒376-8515 桐生市天神町 1-5-1

Polarization Analysis by Digital Holography and Application for Stress Analysis

Yoshitaka TERUI, Masayuki YOKOTA and Ichirou YAMAGUCHI

Department of Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Gunma University, 1-5-1 Tenjincho, Kiryu 376-8515

Digital holographic technique has been applied to analyze the spatial distribution of polarization state of light transmitted through anisotropic objects. The polarization of the reference beam was controlled by an optical fiber Faraday rotator. A method is proposed for suppressing the phase drift during polarization switching. From a polyethyl methacrylate (PMMA) ring, subject to compression, distributions of polarization and principal stresses have been analyzed.

Key words: Faraday rotator, polarization analysis, digital holography, stress analysis

1. はじめに

偏光測定法は、これまでに数々提案されており1-7)、物 体内部構造の異方性の検出や応力分布解析に重要である. 特に二次元的な偏光分布の測定法が注目され、光ヘテロダ イン偏光計測法¹⁾や、干渉偏光計測法²⁻⁴⁾などが提案され ている. これらに対してホログラフィーは,二次元または 三次元の偏光分布測定において簡便で有効な技術である. 特に近年提案されたディジタルホログラフィーによる偏光 測定法8-10)は結像系が不要で、また焦点合わせに機械的な 操作が要らないという利点を有している。 ディジタルホロ グラフィーでは、ホログラムを CCD カメラで記録し、像 の再生はパーソナルコンピューターでフレネル変換を計算 することにより行われ,物体光の複素振幅の三次元分布が 数値的に再生される^{11,12}.したがって,位相および振幅が 数値的に得られるので,定量的な測定に適している.これ までに提案されている方法は, 直交する2つの直線偏 光9,10)や左右円偏光8)の2つの参照光路を用いて軸外し法 によりホログラムを記録するもので, 偏光情報が1枚のホ ログラムに記録できる利点があるが光学系が複雑であり, 独立した2つの参照光がそれぞれの光路の影響を受けると いう欠点があった。そこで筆者らは、単一の参照光路中に 鉛ガラスファイバーを利用したファラデー変調器⁷⁾を導入

し、直線偏光の偏光方位を90°回転することで直交する偏 光を生成し、ホログラムを逐次2枚記録する方式を提案し た13,14). これにより, 直交する2つの直線偏光は同一の参 照光路を通るため,レンズの収差などの影響が等しくな り,解析においても2つの再生像の位置合わせが不要で, 光学系も簡単になる.しかし, 偏光方位を回転するときに ファラデー変調器のコイル電流により発生する熱や、ホロ グラムを逐次記録する間に加わる外乱により干渉縞が移動 するための誤差が生じた。そこで今回,ホログラムに記録 する物体光の一部分に偏光子や波長板を挿入し、偏光状態 が既知となる参照領域を設けた。偏光状態が既知である領 域において, 直交する2つの偏光成分間の位相差は理論的 に求められるので,理論値と実測値との差が外乱により生 じた誤差となる.この値を使って、参照領域以外の物体光 における直交した偏光成分間の再生光波面の位相差補正を 行い、楕円偏光の主軸方位、楕円率などを計算し偏光状態 を解析した。また、偏光解析の応用として、リング状のア クリル樹脂の試料に対して光弾性試験を行い、試料に加え た応力による透過光の偏光状態の変化と、試料に生じた主 応力分布を求めた.また,実験結果と,有限要素法を使っ たシミュレーションソフト (Sybernet 社, ANSYS) に よる計算結果との比較を行った.

E-mail: yokota@el.gunma-u.ac.jp

^{208 (34)}

2. 基本原理

2.1 ホログラム記録・再生法

ディジタルホログラフィーでは、参照光 U_{R} と物体光 Uにより生成されるホログラムが CCD カメラにより記録 される。そのときの CCD 面におけるホログラムの強度 $I_{H}(x, y)$ は、

$$I_{\rm H}(x, y) = |U_{\rm R}(x, y)|^2 + |U(x, y)|^2 + U_{\rm R}(x, y) \cdot U^*(x, y) + U^*_{\rm R}(x, y) \cdot U(x, y)$$
(1)

で与えられる. (x, y) は CCD 面上の座標を表す. CCD 面上における物体光の偏光は、ジョーンズベクトルを用い て表すと $^{9,15)}$

$$U(x, y) = \begin{pmatrix} U_{||}(x, y) \\ U_{\perp}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_{||}(x, y) \exp[i\phi_{||}(x, y)] \\ A_{\perp}(x, y) \exp[i\phi_{\perp}(x, y)] \end{bmatrix}$$

× exp i $\phi_0(x, y)$ (2)

となる.ここで、 $A_{\parallel}(x, y)$ 、 $A_{\perp}(x, y)$ はそれぞれ偏光の 直交する成分(一定の基準方向に対し水平および垂直)の 振幅、 $\phi_{\parallel}(x, y)$ 、 $\phi_{\perp}(x, y)$ はその位相、 ϕ_{0} は初期位相を 表す.直交する偏光の参照光に対して、それぞれホログラ ムを記録する.軸外し法による記録では、参照光が角度 θ_{R} で CCD 面に入射する場合、水平方向の偏光をもつ参照 光は

$$U_{\mathrm{R}||}(x, y) = \begin{bmatrix} A_{\mathrm{R}||} \exp[i(\phi_{\mathrm{R}||} + kx\sin\theta_{\mathrm{R}})] \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

で与えられる.ここで、 $k=2\pi/\lambda$ (λ は波長) である. 同様に垂直方向の偏光をもつ参照光は、

$$U_{\mathrm{R}\perp}(x, y) = \begin{bmatrix} 0 \\ A_{\mathrm{R}\perp} \exp[i(\phi_{\mathrm{R}\perp} + kx\sin\theta_{\mathrm{R}})] \end{bmatrix} \quad (4)$$

となる. 各参照光により得られるホログラム強度は,式 (2), (3), (4)を式(1)に代入して与えられ

$$I_{\mathrm{H}\beta}(x, y) = A_{\mathrm{R}\beta}^{2} + A_{0}^{2} + A_{\beta}(x, y) \exp[\mathrm{i}\phi_{\beta}(x, y)]A_{\mathrm{R}\beta}$$

$$\times \exp[-\mathrm{i}(\phi_{\mathrm{R}\beta} + kx\sin\theta_{\mathrm{R}}) + A_{\beta}(x, y)$$

$$\times \exp[-\mathrm{i}\phi_{\beta}(x, y)]A_{\mathrm{R}\beta}\exp[\mathrm{i}(\phi_{\mathrm{R}\beta} + kx\sin\theta_{\mathrm{R}})]$$
(5)

ただし、 $A_0^2 = A_1^2 + A_1^2$ 、 β は || または 上を意味する. CCD カメラに記録されたホログラムの再生は、ホログラム強度 分布のフレネル変換を計算することにより行われる¹¹⁾. θ_k を十分大きくとれば、0 次光と共役像が横方向に分離して 再生される. 中央が0 次光で、その両側に真の像と共役像 が再生される. ただし、 θ_k は CCD カメラの解像限度によ っても制限される.

ホログラムの再生を行う前に,いくつかの計算処理を施 した.最初に,ホログラムをフーリエ変換し,周波数領域 において真の像の成分だけを残すマスクをかけて,逆フー

36巻4号(2007)

リエ変換することにより、0次光と共役像の成分を除去したホログラムを得る。次に、パーソナルコンピューター (PC)内で数値的に作成した参照光 U_R^* をホログラムに掛けることにより、数値的な参照光の傾きを調整することで 再生像を中央に移動し、再生像の位相分布から軸外し記録 により生じる傾きの成分を除去した^{10,16,17}.

これらの処理を行ったホログラムのフレネル変換を計算 すると、再生面における複素振幅分布 $U_{\rm I}(X, Y, Z)$ は

$$U_{I\beta}(X, Y, Z) = \{ \exp(i2\pi Z/\lambda) / i\lambda Z \} \\ \times \exp[(i\pi/\lambda Z) (X^2 + Y^2)] \\ \times \iint U_{R\beta}^*(x, y) I_{H\beta}(x, y) \\ \times \exp[(i\pi/\lambda Z) (x^2 + y^2)] \\ \times \exp[-(i2\pi/\lambda Z) (xX + yY)] dxdy$$
(6)

で与えられる.ここで、Zは再生距離、(X, Y)は物体 面における座標である.直交する偏光の参照光に対して記 録されたホログラム (式(5))を、式(6)に代入するこ とで、再生像が得られる.このときの複素振幅は、

$$U_{0\perp}(X, Y, -z_0) = |A_{R\perp}|^2 A_{0\perp}(X, Y) \exp[i\phi_{0\perp}(X, Y)]$$
(7)

+

$$U_{0||}(X, Y, -z_0) = |A_{R||}|^2 A_{0||}(X, Y) \exp[i\phi_{0||}(X, Y)]$$
(8)

である.もし、参照光の振幅が等しければ $|A_{\rm RII}|^2 = |A_{\rm RL}|^2$ となるため、物体光の振幅比は

$$\tan \alpha = A_{0\perp}(X, Y) / A_{0\parallel}(X, Y) = |U_{0\perp}| / |U_{0\parallel}|$$
(9)

である。再生像より得られた位相を用いて位相差を計算す ると

$$\Delta \phi(X, Y) = \phi_{0\perp}(X, Y) - \phi_{0\parallel}(X, Y) - \Delta \phi_{\mathbb{R}}$$
(10)

ただし、 △φ_R は参照光の偏光方位の回転時や、外乱によって導入される二度のホログラム記録の間に生ずる位相ド リフトである.この影響を取り除くために、Fig. 1 のよう に物体光路中に 1/4 波長板 (QWP)を挿入することで物 体への入射光の偏光を右円偏光とし、測定物体の一部分を 物体光路中に挿入することで位相ドリフト補正用の参照領 域として領域 A (右円偏光)を設けた.右円偏光の場合、 直交する偏光成分間の位相差は 90°である.よって、この 部分で検出される位相差と理論値の 90°との差が誤差とし て得られる.これによってこの誤差を測定領域の位相差か ら差し引くことにより、外乱の影響を除去できる.

209 (35)

)



Fig. 1 Use of reference area in the object area. A: Reference area (circular polarization), B: measured area.

2.2 偏光解析法

直交する偏光に対する再生像の振幅から振幅比角 $\alpha(X, Y) = \tan^{-1}\{A_{\perp}(X, Y)/A_{\parallel}(X, Y)\}$ を求めて,式(10) から得られた位相差 $\Delta \phi$ とを用いることで,Fig. 2 に示さ れるような楕円偏光の主軸方位角 $\psi(X, Y)$ と楕円率角 $\chi(X, Y)$ を計算して偏光状態が求められる。また、それ ぞれは

$$\psi(X, Y) = (1/2) \tan^{-1} [\tan\{2\alpha(X, Y)\} \\ \times \cos\{\Delta\phi(X, Y)\}]$$
(11)

および

$$\chi(X, Y) = (1/2) \sin^{-1} [\sin\{2\alpha(X, Y)\} \\ \times \sin\{\Delta\phi(X, Y)\}]$$
(12)

で与えられる".

得られた楕円偏光の主軸方位を用いて,主応力を求める ことができる.物体のある点 (X, Y) における互いに直 交した主応力を σ_p , σ_q とし,その方向を p, q 軸とする. それぞれの方位 p, q 軸に対する屈折率変化を Δn_p , Δn_q とすると,次のような関係になることが実験的に確かめら れている.

$$\begin{bmatrix} \Delta n_{p}(X, Y) \\ \Delta n_{q}(X, Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{1} & C_{2} \\ C_{2} & C_{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{p}(X, Y) \\ \sigma_{q}(X, Y) \end{bmatrix}$$
(13)

ここで、 C_1 、 C_2 は光弾性定数である。また、応力とひず みの関係は、厚さ t の板が応力により厚みが変化して t+ Δt となったとすると、試料のヤング率 E とポアソン比 μ を用いて

$$\Delta t(X, Y) = -\frac{\mu t}{E} \{ \sigma_{p}(X, Y) + \sigma_{q}(X, Y) \}$$
(14)

と表せる. 応力印加による位相変化 ϕ は, 応力印加前後 での光路長の変化を ΔL とすると, $\phi = 2\pi \Delta L/\lambda$ で表され るので, n_0 は空気の屈折率, n_s は応力印加前の試料の屈 折率とすると, 応力による p, q 軸偏光成分のそれぞれの 位相変化 $\phi_p(X, Y)$, $\phi_q(X, Y)$ は

$$\begin{bmatrix} \phi_{\mathrm{p}}(X, Y) \\ \phi_{\mathrm{q}}(X, Y) \end{bmatrix} = \frac{2\pi}{\lambda} \begin{bmatrix} \mathcal{L}n_{\mathrm{p}}(X, Y) t - (n_{\mathrm{s}} - n_{0}) \mathcal{L}t(X, Y) \\ \mathcal{L}n_{\mathrm{q}}(X, Y) t - (n_{\mathrm{s}} - n_{0}) \mathcal{L}t(X, Y) \end{bmatrix}$$
(15)

210 (36)



Fig. 2 Polarization ellipse.

となる. これに式 (13), (14) を代入して

$$\begin{bmatrix} \phi_{\mathsf{p}}\left(X, \ Y\right) \\ \phi_{\mathsf{q}}\left(X, \ Y\right) \end{bmatrix} = \frac{2\pi t}{\lambda} \begin{bmatrix} C_1' & C_2' \\ C_2' & C_1' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{\mathsf{p}}\left(X, \ Y\right) \\ \sigma_{\mathsf{q}}\left(X, \ Y\right) \end{bmatrix}$$
(16)

を得る. ただし, C'₁, C'₂は

$$C'_{1} = C_{1} - (n_{\rm s} - n_{\rm 0}) \,\mu/E C'_{2} = C_{2} - (n_{\rm s} - n_{\rm 0}) \,\mu/E$$
(17)

と表される。

応力を印加した光弾性試料では、主応力の方向と複屈折 の方向が一致するため、試料に円偏光を入射させれば、そ の部分での主応力方向にかかわらずに直交する主応力軸に 等しい振幅が分離される。したがって、円偏光を試料に入 射させた場合、試料の透過光の偏光状態から、両主軸方向 p、qに対して45°傾いた楕円偏光が出射する¹⁸⁾.したが って、この楕円偏光の主軸方位を求めれば、主応力の方向 を決定できる.p方向の複素振幅は

$$\begin{bmatrix} U_{p}(X, Y) \\ U_{q}(X, Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi - \pi/4) & \sin(\psi - \pi/4) \\ -\sin(\psi - \pi/4) & \cos(\psi - \pi/4) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} U_{||}(X, Y) \\ U_{\perp}(X, Y) \end{bmatrix}$$
(18)

より求められる.なお、q方向の複素振幅はp方向と直交 するので、式(18)の位相の部分は ($\psi - \pi/4 + \pi/2$) = ($\psi + \pi/4$) で与えられる.

ここで、 $U_p(X, Y)$ と $U_q(X, Y)$ の位相角をとると、 応力印加による位相変化 $\phi_p(X, Y) = \arg[U_p(X, Y)]$ 、 $\phi_q(X, Y) = \arg[U_q(X, Y)]$ を求めることができる。式 (16)より、主応力 $\sigma_p(X, Y)$ 、 $\sigma_q(X, Y)$ の大きさが

$$\begin{bmatrix} \sigma_{\mathrm{p}}(X, Y) \\ \sigma_{\mathrm{q}}(X, Y) \end{bmatrix} = \frac{\lambda}{2\pi t} \begin{bmatrix} C_1' & C_2' \\ C_2' & C_1' \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \phi_{\mathrm{p}}(X, Y) \\ \phi_{\mathrm{q}}(X, Y) \end{bmatrix}$$
(19)

で与えられる.ただし、応力による厚み、屈折率変化の1 次の項だけを考えた.こうして、位相変化 $\phi_p(X, Y)$ 、 $\phi_q(X, Y)$ により、主応力 $\sigma_p(X, Y)$ 、 $\sigma_q(X, Y)$ の分布 が得られる.

光 学



Fig. 3 Experimental setup. LD: laser diode, OI: optical isolator, FFR: flint glass fiber Faraday rotator, BS: beam splitter, L: lens, Pol: polarizer, Amp: current amplifier, PC: personal computer.

3. 実 験

Fig. 3 に実験配置を示す。 波長 785 nm の半導体レーザ - (LD)の出力を、シングルモードファイバーカップラ ーにより参照光と物体光に分けた。参照光は、光ファイバ ー偏光子 Pol 1 により方位 45°の直線偏光で鉛ガラスファ イバーファラデー変調器に入射する. 使用したファラデー 変調器は32.1 deg/Aの変調効率である。したがって、± 1.41 A の直流電流を変調用コイルに印加することで偏光 方位を±45°回転させ、直交する2つの直線偏光を逐次生 成した。物体光は偏光子 Pol 2 により光強度を調整し、偏 光子 Pol 3 および 1/4 波長板 (QWP) により生成した右 円偏光を試料への入射偏光とした。挿入した試料の透過光 と参照光はビームスプリッター (BS) により合波し, CCD 面上にホログラムを形成した。参照光は、物体光に 対して約1°傾けてCCD面に入射させた。CCDカメラ (IMPERX IPX-VGA120) は 512×512 画素, 階調度 8 ビ ットでフレームレート 110 Hz のものを使用した. CCD カメラのピクセルサイズは 7.4 μ m×7.4 μ mで, 偏光子 Pol 2, Pol 3 は消光比 50 dB のグラントムソン偏光子であ る.



Fig. 4 Observation of photoelastic effect occurred in a compressed PMMA ring. The ring was 14.0 mm in diameter, 3.0 mm thickness, which has a hole of $\phi 6.0$ at its center part.

CCD カメラで記録した画像データのフレネル変換を計 算することにより、物体光の複素振幅の再生を行った。得 られた直交する2つの偏光成分間の振幅比と位相差から楕 円の主軸方位角と楕円率角を計算し、偏光状態を解析し た。

4. 結 果

試料は Fig. 4 に示すようなリング状のアクリル樹脂 (PMMA) 板で,直径が 14.0 mm,穴の直径が 6.0 mm, 厚さが 3.0 mm である。その試料に両側から万力で応力 を加えてゆき,応力印加する前と,応力を印加したとき (万力のギャップ変化 2.0% および 2.8% 変化したとき) について,それぞれホログラムを取り込み,解析を行っ た.

試料は CCD 面から 156 mm の位置に置き,試料に対す る入射光は右円偏光とした。照射部分は Fig. 4 の点線で



Fig. 5 Effect of phase compensation. (a) Direct reconstruction, (b) after compensation, (c) cross section at ① and ②.

211 (37)



Fig. 6 Reconstructed amplitude A_{\parallel} , A_{\perp} , and phase ϕ_{\parallel} , ϕ_{\perp} for the horizontal (\parallel) and vertical (\perp) polarizations with calculated amplitude ratio α and phase difference $\Delta \phi$. (a) Initial, (b) low stress.



Fig. 7 Polarization state at 8×8 representative points in each state of compressed sample. (a) Initial, (b) low stress, (c) high stress.

囲んだ部分である. 試料の穴の部分を通過した入射光を参 照領域として用いた. 応力印加前の状態について,補正を 施す前後におけるそれぞれの直交した偏光成分間の位相差 を Fig. 5 (a), (b) に示す. (a) において,参照領域 A の 点線で囲んだ部分の $\Delta\phi$ の平均値は約 69°である. この部 分の理論値は 90°であるので,理論値と参照領域の $\Delta\phi$ の 平均値との差を測定領域,および参照領域から差し引くと



+

Fig. 8 Phase change of direction of p or q. (a) Initial, (b) low stress, (c) high stress.



Fig. 9 Result of phase unwrap. (a) $\phi_{\rm p}$, (b) $\phi_{\rm q}$.

(b) が得られる. (a) と (b) の同じラインについて断面 をとったものを Fig. 5 (c) に示す.

応力印加前,および万力のギャップ変化2.0% (low stress) における再生像の振幅・位相分布,さらに位相差 $\Delta \phi$ と振幅比 α の分布を Fig. 6 に示す. Fig. 6 において, 縁の左側が参照領域 (A) で,右側が測定領域 (B) であ る.

次に、応力印加前後における偏光状態を 8×8 の代表点 において表示した.それを Fig. 7 に示す.弧の左側が参 照領域、右側が測定領域である.ギャップ幅が 2.8% 変化 したときに、測定領域において楕円偏光の主軸方位の分布 が上下で対照的となっていることがわかる.また、それぞ れに対して式 (18) より主応力方位 p、q 軸に対する位相 変化 ϕ_p 、 ϕ_q を求めた.結果を Fig. 8 に示す.応力印加前 や、ギャップ変化 2.0% (low stress) の場合では大きな 変化がみられないが、ギャップ変化 2.8% (high stress) のときには ϕ_p 、 ϕ_q の分布にリングの中心に向かう不連続 な線がみられる.本来、リング圧縮における主応力線図は 連続する分布となる¹⁹⁾.この原因としては、試料に熱処理 していないことによる残留応力の影響やギャップ変化が大 きい場合の試料の変形により偏光状態の導出が不連続にな っていることが要因として挙げられるが、今後詳細な検討

光 学



Fig. 10 Distribution of principal stress σ_p , σ_q obtained by (i) experimental and (ii) simulation (ANSYS). (a) σ_p , (b) σ_q .



Fig. 11 Cross section at line (1)-(3) in Fig. 10 for principal stress of σ_p and σ_q .

が必要であると考えている.

+

主応力方向の位相変化 ϕ_p , ϕ_q に式 (19)を適用すれば, 主応力の大きさが求められる.しかし,このまま主応力を 求めるとすると、主応力方向の位相変化 ϕ_p , ϕ_q は分布に 2π の位相飛びによる縞ができているので、主応力も不連 続となる.よって、主応力方向の位相変化 ϕ_p , ϕ_q に位相 接続を施した.なお、ギャップ変化 2.8% (high stress) の場合には不連続な線が入っているため、ギャップ変化 2.0% (low stress) の場合について位相接続を施した. 位相接続の結果を Fig.9 に示す.ここでは、参照領域の 結果は取り除いて、測定領域の位相接続の結果のみを表示 している.この結果を用いて、アクリル樹脂の光弾性定数 を参考文献 20 から、 n_s =1.5、E=0.3 Mpa、 μ =0.23、 C'_1 =-1.15×10⁻¹⁰m²·N⁻¹、 C'_2 =-1.03×10⁻¹⁰m²·N⁻¹の ように引用して、主応力 σ_p 、 σ_q の分布を求めた.結果を Fig. 10 に示す.実験結果と比較するために、有限要素法

36巻4号 (2007)

213 (39)

を用いて,応力分布の数値計算(ANSYSを使用)を行った.数値計算では,実験に使用したアクリル樹脂の形状と,文献20より引用した光弾性定数を使用した.

Fig. 10 の ① から ③ のラインについて断面を求めて, 実験結果と計算結果を比較した。結果を Fig. 11 に示す。 点線が計算結果,実線が実験より得られた結果である。こ れらのグラフから,主応力 σ_p , σ_q ともに,計算結果と実 験結果は一致してはいないが,数値的に近い範囲で同じよ うな変化をしていることがわかる。有限要素法による計算 方法や光弾性定数などの数値の与え方により,計算結果, 実験結果ともに変化すると考えられる。より詳細な数値計 算や試料の光弾性定数を求めて,検討を進めることが今後 の課題であろう。

5. 結 論

ファラデー変調器を用いて,直交する2つの偏光の参照 光をつくり出すディジタルホログラフィーによる偏光解析 の実験を行った.試料にはリング状のアクリル樹脂 (PMMA)板試料を用い,応力印加による光弾性効果の実 験を行った.解析では,外乱による影響を物体光の一部に 参照領域を設けることにより除去した.さらに,主軸方位 から求めた主応力方向の位相変化 φ, φ を求め,主応力 の大きさを求めて,有限要素法による計算結果と比較を行 った.試料の熱処理やより詳細な光弾性定数が得られれ ば,より詳細な比較検討が可能になると考えられる.ま た,今回使用したアクリル樹脂よりも大きな光弾性定数を もつエポキシ樹脂などを試料に用いれば,より顕著な光弾 性効果が期待できるため,小さな応力に対しても明瞭な結 果が得られるであろう.

文 献

- T. Yamaguchi, K. Oka and Y. Ohtsuka: "Dynamic photoelastic analysis by optical heterodyne polarimetry," Opt. Rev., 1 (1994) 276-277.
- 2) J. F. de Boer, T. E. Milner, M. J. C. van Gemert and J. S. Nelson: "Two-dimensional birefringence imaging in biological tissue by polarization-sensitive optical coherence tomography," Opt. Lett., 22 (1997) 934–936.
- 3) J. Lesso, A. Duncan, W. Sibbett and M. Padgett: "Surface

profilometry based on polarization analysis," Opt. Lett., 23 (1998) 1800-1802.

- 4) J. Moreau, V. Loriette and A.-C. Boccara: "Full-field birefringence imaging by thermal-light polarization-sensitive optical coherence tomography. 2. Instrument and results," Appl. Opt., 42 (2003) 3811–3817.
- 5) K. Oka and Y. Ohtsuka: "Polarimetry for spatiotemporal photoelastic analysis," Exp. Mech., **33** (1993) 44-48.
- Y. Ohtsuka and K. Oka: "Contour mapping of the spatiotemporal state of polarization of light," Appl. Opt., 33 (1994) 2633-2636.
- M. Yokota, Y. Sato, I. Yamaguchi, T. Kenmochi and T. Yoshino: "A compact polarimetric glucose sensor using a high-performance fiber-optic Faraday rotator," Meas. Sci. Technol., 15 (2004) 143-147.
- D. Beghuin, E. Cuche, P. Dahlgren, C. Depeursinge, G. Delacretaz and R. Salathe: "Single acquisition polarization imagine with digital holography," Electron Lett., 35 (1999) 2053–2055.
- T. Colomb, P. Dahlgren, D. Beghuin, E. Cuche, P. Marquet and C. Depeursinge: "Polarization imaging by use of digital holography," Appl. Opt., 41 (2002) 27-37.
- T. Colomb, E. Cuche, F. Montfort, P. Marquet and C. Depeursinge: "Jones vector imaging by use of digital holography: Simulation and experimentation," Opt. Commun., 231 (2004) 137-147.
- U. Schnars and W. Juptner: "Direct recording of holograms by a CCD target and numerical reconstruction," Appl. Opt., 33 (1994) 179-180.
- I. Yamaguchi and T. Zhang: "Phase-shifting digital holography," Opt. Lett., 22 (1997) 1268–1270.
- 13) 横田正幸,照井義隆,山口一郎:"デジタルホログラフィに よる偏光分布の解析", Proceedings of 35th Meeting on Lightwave Sensing Technology (2005) pp. 49-54.
- 14) M. Yokota, Y. Terui and I. Yamaguchi: "Analysis of polarization state by digital holography with polarization modulation," Opt. Rev., 13 (2006) 405-409.
- M. Born and E. Wolf: *Principles of Optics*, 4th ed. (Pergamon Press, 1970).
- 16) E. Cuche, P. Marquet and C. Depeursinge: "Simultaneous amplitude-contrast and quantitative phase-contrast microscopy by numerical reconstruction of Fresnel off-axis holograms," Appl. Opt., 38 (1999) 6994–7001.
- E. Cuche, P. Marquet and C. Depeursinge: "Spatial filtering for zero-order and twin-image elimination in digital off-axis holography," Appl. Opt., 39 (2000) 4070-4075.
- 18) 岡 和彦,大塚 喜弘:"偏光計測を利用した動的光弾性に よる時空間応力解析", Proceedings of 8th Meeting on Lightwave Sensing Technology (1991) pp. 23-30.
- 19) 辻 次郎,西田正孝,河田幸三:光弾性実験法(日刊工業新 聞社,1977)1-50.
- 20)清水紘治,高橋 賞: "光学定数の測定法について",日本機 械学会論文集(A編),519(1989)2342-2347.